

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
[7] ナフタレン	<p>【水質】</p> <p>水質試料 1,000mL</p> <p>溶媒抽出 ヘキサン 2mL 攪拌30分間 振とう1分間</p> <p>分取 ヘキサン層 0.5mL</p> <p>GC/HRMS-SIM-EI</p> <p>「平成27年度化学物質分析法開発調査報告書」に準拠</p>	<p>分析原理：GC/HRMS-SIM-EI</p> <p>検出下限値： 【水質】(ng/L) [7] 0.11</p> <p>分析条件： 機器 GC：Agilent 6890N MS：JEOL JMS-800D 又は GC：Agilent 6890 MS：Waters AutoSpec Ultima カラム Agilent Select PAH 30m×0.25mm、0.15μm</p>
	<p>【底質】</p> <p>底質試料 湿泥 30g-wet (乾泥15g-dry相当) ハイマトリックス 16g (m3gは洗い込み用) 還元銅 9g</p> <p>高速溶媒抽出 アeton/ヘキサン(50:50) 100、1,500psi ×2回</p> <p>希釈 精製水 300mL 塩化ナトリウム 15g</p> <p>溶媒抽出 ヘキサン 1回目数mL、2回目50mL 振とう10分間 ×2回</p> <p>脱水 無水硫酸ナトリウム</p> <p>濃縮 ロ-トリ-エハ ホレタ、 25 3~4mLまで</p> <p>定容 ヘキサン 4mL</p> <p>分取 1mL</p> <p>カラムクリー アップ シリカ 1g 溶出：ジクロロメタン/ヘキサン (5:95) 20mL</p> <p>濃縮 ロ-トリ-エハ ホレタ、 25 3~4mLまで</p> <p>濃縮 窒素 ハーシ、25 0.5~1mLまで</p> <p>定容 ヘキサン 1mL</p> <p>GC/HRMS-SIM-EI</p> <p>注) GC/HRMS-SIMからGC/MS/MS-MRMに変更した例があった。</p> <p>「平成28年度化学物質分析法開発調査報告書」に準拠</p>	<p>分析原理：GC/HRMS-SIM-EI</p> <p>検出下限値： 【底質】(ng/g-dry) [7] 0.34</p> <p>分析条件： 機器 GC：Agilent 6890N MS：JEOL JMS-800D 又は GC：Agilent 7890B MS：Agilent 7010B カラム Agilent Select PAH 30m×0.25mm、0.15μm 又は Penomenex ZB50 30m×0.25mm、0.15μm</p>